

上海科技大学材料器件中心公共科研平台

2026 年研发工艺线培训收费标准

发布单位：上海科技大学材料器件中心

生效日期：2026 年 4 月 15 日

一、设备分级培训收费标准及获取授权方式

设备类型	收费标准		授权标准
1 级设备	按工程师指导的培训/ 观摩/考核 的次数收费	100 元/次·人	由工程师培训 1 次、签订承诺书后直接授权
2 级设备		200 元/次·人	观摩用户操作 1 次或工程师培训 1 次后，考核通过者予以授权
3 级设备		500 元/次·人	工程师培训 1 次+观摩工程师或用户操作 2 次，考核通过者予以授权
4 级设备		500 元/次·人	工程师培训+观摩工程师操作累计 3 次后，考核通过者予以授权
5 级设备	不开放用户授权，仅提供平台代工服务		

二、收费说明

1. 费用包含工程师指导、设备使用、培训材料等费用。
2. 日常培训需通过中心官网-“培训日历”预约，临时取消需提前 24 小时通知，
培训日历地址：<https://smdl.shanghaitech.edu.cn/13217/list.htm>。
3. 综合培训费：2100 元/人次（含六台一级设备培训费 600 元/人次）。
4. 加急集中培训、代工培训等收费另行规定，可联系闫老师，
yanxm@shanghaitech.edu.cn

三、各设备培训等级对照表

服务类型	设备名称	设备编号	设备级别
光刻工艺服务	显影通风橱	1-7	1级
光刻工艺服务	显影通风橱(大仪名称: 普通化学清洗槽)	1-8	1级
光刻工艺服务	显影通风橱(大仪名称: 普通化学清洗槽)	1-16B	1级
光刻工艺服务	真空烘箱	1-11	1级
光刻工艺服务	净化烘箱	1-12	1级
光刻工艺服务	高温烘箱	1-10	1级
湿法工艺服务	小样品有机清洗通风橱(大仪名称: 普通化学通风柜 4)	2-2	1级
湿法工艺服务	HF 及 BOE 专用通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台通风橱 3)	2-4	1级
湿法工艺服务	普通酸刻蚀及清洗通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台通风橱 2)	2-5	1级
湿法工艺服务	金属刻蚀及超声清洗通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台)	2-6	1级
湿法工艺服务	甩干机 四六寸晶圆	2-7	1级
湿法工艺服务	甩干机 四八寸晶圆	2-8	1级
湿法工艺服务	晶圆甩干机 四六寸晶圆	2-11B	1级
光刻工艺服务	匀胶通风橱(大仪名称: 普通化学清洗槽)	1-17B	2级
光刻工艺服务	匀胶通风橱(大仪名称: 有机清洗通风橱)	1-5	2级
光刻工艺服务	匀胶通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台)	1-6	2级
光刻工艺服务	HMDS 烘箱	1-9	2级
光刻工艺服务	低温恒温水槽	1-15B	2级
湿法工艺服务	晶圆清洗刻蚀通风橱	2-09B	2级
湿法工艺服务	RCA 晶圆清洗通风橱	2-10B	2级
湿法工艺服务	氮化物清洗槽 磷酸	2-3	2级
湿法工艺服务	6 寸有机清洗通风橱(大仪名称: 1.5M 酸碱通风柜)	2-1	2级

后道工艺服务	减薄抛光系统 lapping	5-3B	4 级
后道工艺服务	减薄抛光系统 抛光机 CMP	5-5B	2 级
后道工艺服务	打线机 (7476D)	5-1	2 级
量测技术服务	高真空离子溅射仪 SEM 制样磁控溅射	4-14	2 级
量测技术服务	椭偏仪 (IR-VASE Mark II M-2000UI)	4-10	2 级
量测技术服务	椭偏仪 IR	4-4	2 级
量测技术服务	白光轮廓仪 3D Laser	4-9	2 级
量测技术服务	光谱反射膜厚仪 Filmmetrics(F50-UV)	4-7	2 级
量测技术服务	表面轮廓仪 KLA 台阶仪	4-5B	2 级
量测技术服务	线性扫描轮廓仪	4-6	2 级
量测技术服务	光学显微镜(大仪名称: 显微镜)	4-12	2 级
量测技术服务	显微镜 (DM4M M205C)	4-8	2 级
量测技术服务	显微镜 (M2700M)	4-13	2 级
量测技术服务	应力测量仪	4-11	2 级
其他工艺服务	临界点干燥仪	6-2	2 级
镀膜工艺服务	磁控溅射沉积系统 Mo-Cu 镀膜机	3-9	5 级
镀膜工艺服务	电子束沉积系统 非磁性金属镀膜 (PVD200)	3-10	5 级
镀膜工艺服务	化学气相沉积系统(PECVD)	3-11	3 级
镀膜工艺服务	原子层积系统 ALD	3-16	3 级
镀膜工艺服务	多靶材溅射仪 SPUTTER 介质镀膜 PVD3	3-5	5 级
镀膜工艺服务	多靶材溅射仪 SPUTTER 磁性金属镀膜 PVD2	3-6	3 级
镀膜工艺服务	多靶材溅射仪 SPUTTER 非磁性金属镀膜 PVD1	3-7	3 级
镀膜工艺服务	热蒸发 (国产 Al、In)	3-3	3 级
镀膜工艺服务	多源炉电子束蒸发系统 金属镀膜	3-4	3 级
镀膜工艺服务	有机高分子镀膜机	3-25B	3 级
镀膜工艺服务	晶圆电镀系统	3-26B	3 级
镀膜工艺服务	高深宽比金属柱制备系统	3-27	3 级



刻蚀工艺服务	双离子源刻蚀系统 IBE	3-2	3 级
刻蚀工艺服务	等离子刻蚀系统 三五族刻蚀机	3-14	3 级
刻蚀工艺服务	高功率等离子体刻蚀机 不含钨的三五族刻蚀机	3-18	3 级
刻蚀工艺服务	反应离子刻蚀系统	3-13	3 级
刻蚀工艺服务	反应离子刻蚀机 (鲁汶 ICP)	3-20	3 级
刻蚀工艺服务	氟化氙刻蚀仪 XEF2 ETCHER	3-19	3 级
刻蚀工艺服务	HF 干法刻蚀机	3-22	3 级
刻蚀工艺服务	等离子去胶机 Asher	3-23	3 级
后道工艺服务	贴片机	5-2	3 级
量测技术服务	原子力显微镜 AFM	4-3	3 级
量测技术服务	3D 电子扫描显微镜 SEM	4-1	3 级
量测技术服务	3D 电子扫描显微镜 SEM	4-15	3 级
量测技术服务	高分辨 X 射线衍射仪	4-17B	3 级
量测技术服务	低温光电测试系统	4-18	3 级
量测技术服务	手动探针测试系统	4-19B	3 级
其他工艺服务	快速退火炉 RTA	6-1	3 级
光刻工艺服务	3D 电子扫描显微镜半自动 EBL	1-14B	4 级
光刻工艺服务	接触式光刻系统	1-1	4 级
光刻工艺服务	高速高分辨率无掩模板光刻仪 MLA	1-3	4 级
光刻工艺服务	投影数字光刻系统 (MiScan)	1-18	4 级
镀膜工艺服务	电子束金属蒸发系统	3-28	4 级
后道工艺服务	倒焊机	5-6	4 级
量测技术服务	聚焦离子束显微镜	4-16B	4 级
光刻工艺服务	步进式光刻机	1-4	5 级
光刻工艺服务	电子束曝光机全自动 EBL	1-13B	5 级
光刻工艺服务	自动涂胶显影机	1-2	5 级
镀膜工艺服务	氮化铝集成溅射仪	3-8	5 级
镀膜工艺服务	低压化学气相沉积系统 LPCVD	3-24B	5 级
镀膜工艺服务	化学气相沉积系统(ICPCVD)	3-12	5 级

刻蚀工艺服务	深硅刻蚀机	3-21	5 级
刻蚀工艺服务	HBR 刻蚀机 硅刻蚀	3-15	5 级
刻蚀工艺服务	ICP 介质刻蚀机 硅基材料刻蚀机	3-17	5 级
后道工艺服务	划片机 Dicing saw	5-4B	5 级

十